(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-299751 (P2002-299751A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51) Int.Cl.7	微別記号			FI.			テーマコード(参考)					
H01S	5/026	616		H0	1 S	5/026	616 5F073				7 3	
	5/0683					5/0683	5 K O O 2					
H 0 4 B	10/28			H0-	4 B	9/00	Y					
	10/26				L							
	10/14											
			審査請求	未醋求	农锸	頌の数6	OL	(全	8 頁)	最終	頁に統ぐ	
(21)出顯番号		特顧2001-102920(P2001-102920)		(71) 出顧人 000005108								
						株式会	社日立	製作所				
(22)出顧日		平成13年4月2日(200			東京都	千代田	区神田	駿河台	四丁目 6	番地		
			(72)	首 直江	和彦							
					神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株							
				式会社日立製作所通信事業部内								
				(72)	発明	省 湯浅	堂司					
				神奈川県横浜市)			市戸場	三塚区戸塚町216番地 株				
				式会社日立製作所通信事業部内								
				(74)	代理》	人 100068	100068504					
						弁理士	小川	勝男	外	2名)		
										最終	質に続く	

(54) 【発明の名称】 半導体レーザ装置及びそれを用いた光送信装置。

(57)【要約】

【課題】 幹線系光伝送の重要な部品の一つである、半 導体電界吸収型変調器集積レーザの本質である前後比直 線性の不具合を改善する。

【解決手段】EA変調器集積レーザ106の後方出力であるモニタ電流Ipを、非線型アンプ402によって、電気的に補正し、前方出力と同様にEA変調器部を通過したあとのような電流出力にして、レーザ駆動電流源103を制御することにより前方後方比の電流依存性を抑制する。

【効果】後方モニタ電流を非線型に変換して、この電気信号をレーザ駆動電流として出力することで、これを搭載した半導体レーザモジュール及び光送信モジュールにて補正するため、半導体レーザモジュール及び光送信モジュールの光出力安定性や信頼性が向上する。

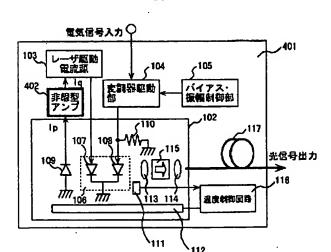


図 4

20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体電界吸収型変調器集積レーザの前方 出力光を光ファイバーに光学的に結合させる光学手段 と、上記導体電界吸収型変調器集積レーザの後方出力光 をモニタするモニターフォトダイオードと、上記モニタ ーフォトダイオードによって制御され、上記半導体電界 吸収型変調器集積レーザの半導体レーザの駆動電流を発 生するレーザ駆動電源とを持つ半導体レーザ装置におい て、

上記モニターフォトダイオードと上記レーザ駆動電源と の間に上記モニターフォトダイオード出力モニタ電流が 上記レーザ駆動電流の値に対して増幅率が変わる非線型 アンプを設けたことを特徴とする半導体レーザ装置。

【請求項2】上記半導体電界吸収型変調器集積レーザの 半導体レーザが波長可変レーザで構成されたことを特徴 とする請求項1記載の半導体レーザ装置。

【請求項3】請求項1又は2記載の半導体レーザ装置の 上記半導体電界吸収型変調器集積レーザと、上記光学手 段と、上記モニターフォトダイオードと、上記非線型ア ンプとが搭載された半導体レーザモジュール。

【請求項4】請求項3記載の半導体レーザモジュールで あって、更に上記半導体電界吸収型変調器集積レーザ内 の電界吸収型変調器を駆動する変調器駆動部が搭載され た半導体レーザモジュール。

【請求項5】請求項1又は2記載の半導体レーザ装置の 上記半導体電界吸収型変調器集積レーザ、上記光学手段 と、上記モニターフォトダイオードと、上記レーザ駆動 電源と、上記非線型アンプと、上記半導体電界吸収型変 調器集積レーザの電界吸収型変調器を駆動する変調器駆 動部とが搭載された光送信モジュール。

【請求項6】請求項1記載の半導体レーザ装置及び上記 半導体電界吸収型変調器集積レーザ内の電界吸収型変調 器を駆動する変調器駆動部を搭載した光送信装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明に属する技術分野】本発明は、半導体レーザ装置 及びそれを用いた光伝送装置、さらに詳しく言えば、半 導体電界吸収型変調器集積レーザで、半導体レーザの出 力の一部をモニタして、半導体レーザの駆動電流を制御 し、半導体レーザの光出力を制御する半導体電界吸収型 変調器集積光源を用いた光伝送装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、光通信システムに使用される半導 体電界吸収型変調器集積光源は、伝送速度が10Gbit/s程 度のものでは、図1に示す光送信モジュール構造のもの が知られている。光送信モジュール101は、そのパッ ケージ内部に、レーザモジュール102、レーザ駆動電 流源103、変調器駆動部104、バイアス振幅制御部 105及び温度制御回路116を設けて構成されてい

収型変調器集積レーザ (以下、EA (electro-absorpti on) 変調器集積レーザと略称) 106が、ペルチェ基板 112上に搭載されている。EA変調器集積レーザ10 6は、一定電流により駆動させる分布帰還レーザ (Dist ributed feedback laser、以下DFBレーザと略称) 部 107と、変調電圧により動作させるEA変調器部10 8により構成されている。EA変調器とは、EA変調器 部に電圧を印加することにより生じる量子閉じ込めシュ タルク効果を利用して、EA変調器部活性層吸収端をシ フトさせることにより、DFBレーザの光をオン・オフ する変調器である。EA変調器について記載した文献と しては、; MAoki, et.al., "High-speed(10Gbit/s) and low-drive-voltage(1V peak to peak) InGaAs/InG aAsP MQW electroabsorption modulator integrated DF B laser with semi-insulating buried heterostructur e, Electron. Lett., vol.28, pp. 1157-1158, 1992. がある。

2

【0003】EA変調器108には、終端抵抗110が 並列に搭載されており、インピーダンス整合を取ってい る。また、EA変調器集積レーザ106の前方はレーザ からの光cをレンズ113、アイソレータ115及びレ ンズ114を介して光ファイバ117に結合する光学手 段が設けられている。さらに、EA変調器集積レーザの 後方には、光出力モニタ用フォトダイオード109が搭 載されている。フォトダイオード109により光電気 (O/E)変換されたモニタ電流 I mがレーザ駆動電流 源103を通りDFBレーザ107を制御して、レーザ 107の光出力を一定に保つ、いわゆるオート・パワー 制御(APC)ループを形成している。ここで、レーザ駆 動電流源103はいずれも入力電流に対して、線形に出 力する。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】EA変調器集積レーザ を搭載した光送信装置、現在製品化されている伝送距離 40kmのものに加え、今後80km、及び100km 以上の長距離伝送化が進んでいく。長距離伝送化が進ん だ場合、EA変調器集積レーザにおいては、高光出力 化、低チャープ化及び大消光比化の特性が要求される。 EA変調器集積レーザにおいてこれらの特性を向上させ、 た場合、それに伴って劣化する特性は、下述の前方後方 比直線性 $\Delta P f / \Delta I m$ である。なぜなら、いずれの特 性を向上させる場合においても、EA変調器集積レーザ EA変調器部での光吸収が大きくなり、EA変調器集積 レーザ前方光出力の直線性にレーザ駆動電流に対して非 線型な影響を与えるため、素子自体の前方後方比直線性 が劣化してしまうためである。このことを更に詳しく説 明する。EA変調器集積光源のEA変調器集積レーザ1 06は、DFBレーザ107の前方にEA変調器108 が集積されている。EA変調器はその性質上、電圧を印 る。レーザモジュール102の要部には、半導体電界吸 50 加しない状態においても、DFBレーザ107からの光

を吸収する。従って、EA変調器集積レーザ106の前方からの光での出力は、DFBレーザ107の光出力はにEA変調器部の光吸収が引かれた光出力として取り出される。一方、EA変調器集積レーザ106後方からの光めの出力は、後方にはEA変調器がないため、DFBレーザの光出力がそのまま取り出される。

【0005】また、EA変調器集積光源をAPC制御で 安定に動作させるためには、モニターしているEA変調器集積レーザ後方光出力bと前方光出力cとの比がレーザの駆動電流範囲で一定の値に保たれなければならない。なぜなら、例えばある電流増加量に対して、後方光出力が2倍になった時、前方光出力が1.5倍にしかならなかったら後方光出力モニタによるAPC制御で、前方光出力を安定に制御させることが不可能となるからである。

【0006】従来のEA変調器集積光源では、フォトダイオード109からの出力信号とレンズ114の光出力の関係は、図2に示すように、フォトダイオード109からの出力信号Ipを点線で示し、レンズ114の光出力loを実線で示す。ここで出力信号Ip及びloは、レー20ザの駆動電流;If=150mAの出力で規格化しているため、縦軸は絶対値ではない。

【0007】図2において、EA変調器108前方からの 光cの出力Ioは、同後方からの出力Ipとは、規格化し ているにも関わらず完全に一致せず、特に駆動電流 I f が、しきい値電流 I thから約80 m A の領域で、出力Io (実線)が小さくなっている。これは、EA変調器集積 レーザ107の前方に、EA変調器108が集積されて いることに起因している。レーザ107前方からの光a の出力は、EA変調器108を通過した後、レンズ11 30 3、114、アイソレータ115を介して光ファイバ1 17から出力されるため、DFBレーザ107の光は、 同一素子に集積されているEA変調器108によって吸 収を受ける。この吸収はEA変調器108を駆動してい ない状態、つまりEA変調器部にバイアスをかけていな い状態でも、光電流にして10mA前後生じ、さらにレ ーザ駆動電流がしきい値電流 (Ith) から80 mAの領 域で顕著に発生する。一方、EA変調器集積レーザの後 方には、何も吸収体が集積されていないため、フォトダ イオード109との間に結合損が生じるものの、DFB 40 レーザ107の出力に比例した値がフォトダイオードの 106の出力になる。

【0008】レーザモジュール106は、後方出力をモニタすることにより前方光出力を一定に制御している。そのため、レーザ駆動電流 I f が変わった場合においても、後方出力に対して前方出力の比が、ある範囲で一定でなければ、レーザ駆動電流 I f が変わる前と同様な前方出力に制御することができない。

【0009】このことに関して、後方の出力 I mと前方の出力 P f の比を前方後方比として、実際の E A 変調機 50

集積レーザの電流依存性を図3に示す。同図中、従来の電流依存性を実線Aで示すように、駆動電流Ifにより前方後方比が変動していることが分かる。これは、図2での後方の光出力Ipと前方の光出力Ioの違いによるものである。EA変調器部の光吸収が顕著であるような光出力を発生させるレーザ駆動電流If領域、すなわちレーザ駆動電流Ifがしきい値電流から80mAの領域においては、前方後方比が一定でなく、レーザ駆動電流If増加に伴い増加傾向である。一方、EA変調器部の光吸収が飽和レベルであるような光出力を発生させるレーザ駆動電流領域では、レーザ駆動電流Ifに対し前方後方比はほぼ一定である。

【0010】通常、レーザ駆動電流は、If=60~8 0mAであるが、長期に渡る信頼性を保証するためには、50%増加の値、つまりIf=90~120mAまで保証する必要がある。従って、例えば初期にIf=70mAで動作させているモジュールは、駆動電流範囲であるしさい値以Ith上の電流、例えば30mAから105mAまでの動作を保証しなければならが、図3に示す通り前後比がIf=30mAと105mAでは前方後方比が20%程度変動が生じており、この変動が20%を超えると、光出力信号を一定に動作させることが困難となる。この許容値の指標として、前方後方出力比の電流変動を

 $\Delta Pf/\Delta I m = { \{Pf(105mA)/Pf(30mA) \} / \{ I m(105mA) / I m(30mA) \} \} -1}$

で定義した場合、この値が±20%以下でなければ、前述の通り長期に渡り信頼性が保証できない。これに加えてEA変調器は、ある光入力レベルにおいて、飽和傾向があるため、より一層この後方光出力と前方光出力との比に変動が生じてしまう。従って、後方光出力をモニターフォトダイオードで線型に電気変換して、レーザ駆動電流を制御する場合、後方光出力と前方光出力との比に変動が生じると、レーザ前方の光出力を一定に制御することが困難になる。

【0011】このため、従来は、動作電流をIf=65m Aで行うことにより、前後比直線性の値が実力+15~+22%に対して、±20%以下でレーザ素子の選別することにより、本光送信モジュールの高信頼性を実現している。従って製品の歩留まりが悪く非経済的であり、動作電流の広い範囲にわたっての使用を可能にし、製品寿命を長くすることができない。この変動は、EA変調器の特性、例えば消光特性によって変わることが分かっており、長距離伝送用に設計された半導体EA変調器集積レーザを使用した光伝送装置においては、より顕著にこの変動が生じる問題がある。

【0012】従って、本発明の主な目的は、半導体レーザの駆動電流が広範囲にわたって後方光出力と前方光出力との比に変動が小さい電界吸収型変調器集積レーザ装置及びそれを使用した光伝送装置を実現することであ

る。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、半導体電界吸収型変調器集積レーザの前方出力光を光ファイバーに光学的に結合させる光学手段と、上記導体電界吸収型変調器集積レーザの後方出力光をモニタするモニターフォトダイオードと、上記モニターフォトダイオードによって制御され、上記半導体電界吸収型変調器集積レーザの半導体レーザの駆動電流を発生するレーザ駆動電源とを持つ半導体レーザ装置において、上記モニターフォトダイオードと上記レーザ駆動電源との間に上記モニターフォトダイオード出力モニタ電流が上記レーザ駆動電流の値に対して増幅率が変わる非線型アンプを設けて構成される。ここで、半導体レーザ装置とは、実施例で述べるレーザモジュール、光送信モジュール及び光送受信モジュールを含む。

【0014】本発明は、上記制御手段によって、後方モニタ電流を非線アンプで変換して、その変換された電流をレーザ駆動電流として出力することで、従来の電界吸収型EA変調器集積光源の不具合を解決している。前述 20の非線型アンプは、半導体EA変調器集積レーザがもつ前方後方比直線性の駆動電流電流に対する変動を補正する機能を有するものである。

[0015]

【発明の実施の形態】<実施例1>図4は、本発明による光伝送装置(光送信モジュール)の一実施例の構成図である。本実施例は、伝送速度10Gbit/sのEA変調器集積レーザを搭載したものである。光送信モジュール401の基本構成は、従来の技術の図1での説明とほぼ同様である。図1と実質的に同じ構成部分には図1と同じ番号、符号を付して詳細な説明を省く。図1のものとの構成上の違いは、フォトダイオード109により〇/E変換された出力電流 Ipを非線型アンプ402を介してレーザ光出力安定回路に入れる点である。

【0016】非線型アンプ402は、モニタ電流 I pを 入力として、これを非線型に変換し出力する。非線型ア ンプ402の出力電流 I qはレーザ駆動電流源103を 介して半導体レーザ107の入力となる。この非線型な 変換とは、入力であるモニタ電流Ipのレベルに対して 増幅率が変わるような変換を意味する。具体的には、E A変調器集積レーザ106の前方光出力が小さく、EA 変調器集積レーザ前方に集積されているEA変調器10 8における光吸収が飽和レベルに達していおらず顕著な 光吸収が見られる範囲の場合、このときの非線型アンプ の増幅率をN1とする。一方、EA変調器108部にお いてそれに集積されたレーザの光入力に対する光吸収が 飽和領域に達しているようなEA変調器集積レーザ前方 光出力レベルの場合、言いかえるとEA変調器部光電流 がレーザ光入力に対して飽和レベルに達している領域の 場合、このときの非線型アンプ402の増幅率をN2と する。それぞれの領域における非線型アンプの増幅率に N1<N2の関係を持たせるような変換で、非線型な変 物を定義する

【0017】以上の説明から分かるように、非線型な変換とは本来EA変調器集積レーザのEA変調器部への光入力レベルによって増幅率を変えるべきであるが、このEA変調器への光入力は、モニタ電流の入力レベルと一対一に対応しているため、モニタ電流Ipの入力レベルに対して増幅率が変わるような変換で本発明の効果は得られる。さらにEA変調器108への光入力は、EA変調器集積レーザの駆動電流とも一対一に対応しているため、非線型な変換は、レーザ駆動電流の領域に対して増幅率が変わる変換とも定義することができる。非線型アンプ402の特性例について、図5及び図6を用いて説明する。

【0018】図5は、レーザ駆動電流 I f に対する非線型アンプ出力、図6はレーザ駆動電流 I f に対して非線型アンプの増幅率を示したグラフであり、いずれも、2つの非線型アンプAとBの2例の場合を示している。

【0019】図5及び図6に示したの場合の増幅作用について説明する。第1の例である非線形アンプAは、EA変調器108における光吸収が飽和レベルに達していおらず顕著な光吸収が見られる範囲であるしきい値 Ithから約80mAのレーザ駆動電流領域においては、図5及び図6に示すとおり増幅率がN1である。一方、EA変調器部光電流がレーザ光入力に対して飽和レベルに達している70mA以上のレーザ駆動電流 I f 領域の増幅率をN2とすると、増幅率N1<N2の関係となる。

【0020】別の例である非線型アンプBについて図5 及び図6について示す。非線型アンプBの特性は、しきい値Ithから70mAの領域では、増幅率N3がIfの関数となることであるが、この場合も増幅率N3レーザ駆動電流70mA以上の領域の増幅率N4との関係は、N3(If) < N4となる。実際の使用においては、非線型アンプ402は、EA変調器集積レーザの特性に応じて、AタイプやBタイプを使い分けることが可能である。このような非線型アンプ402は、能動素子と受動素子との組み合せによる回路形成、あるいはマイクロコンピュータに所望の増幅率をプログラミングすることにより実現40が可能である。

【0021】図7は上記非線形アンプの構成例のブロック図である。非線形アンプ402はモニタ電流 I pを電圧に変える電流・電圧変換回路403と、予め前方出力情報が書き込まれているメモリ(ROM)404と、電流・電圧変換回路403の出力電圧を上記前方出力情報を基に補正するプログラムを実行する小型プロセッサで構成された前方後方補正回路405で構成されている。

【0022】図8は、非線型アンプ402の特性図である。非線型アンプ402の動作に関して、レーザ駆動電50 流Ifを基準にして、具体的に説明する。非線型アンプ

402を入力であるモニタ電流 I pは、図8の非線型アンプ入力 I pに示す通りであるが、非線型アンプ出力 I qは、図8の特性 I qに示すモニタ電流に変換される。ここで図8の電流 I p及び I qは、レーザ駆動電流 If = 150mAの出力で規格化しているため、縦軸は絶対値ではない。この非線型アンプ402を介したモニタ電流 I qと、レーザ前方の光出力 Ioとの比について、電流依存性を取ると、図3の点線 Bに示すように、電流依存性が従来のものに比べて小さいことが分かる。従って、レーザ駆動電流 I f が変わった場合においても、後方出力 10に対して前方出力の比がほぼ一定であるため、レーザ駆動電流 I f が変わる前と同様の前方出力に制御することできる。

【0023】例えば初期に駆動電流If =70mAで動作 させているモジュールは、駆動電流範囲である最小電流 値;30mA~最大電流値;105mAまでの動作を保 証しなければならいが、図3に示す通り、前方後方比B がIf=30mAと105mAでは変動が従来Aより小さ いため、電流が変動した場合においても、光出力信号を ±10%程度の範囲で一定に動作させることができる。 前後比直線性の電流変動ΔPf/ΔIm (従来の技術参 照)の指標で示すと、前後比直線性の値が従来の+15 ~+22%から、0%を中心とした±10%分布に改善 することができる。この改善効果は、非線型アンプによ りモニタ電流を、レーザの前方光出力と同様の駆動電流 依存性に変換することによって得ることができる。ま た、非線型アンプの特性により、非線型アンプで変換し た後のモニタ電流の駆動電流に対する依存性が決り、さ らには前後比直線性の電流依存性も決めることができ る。従って、光送信モジュールとして、所望の前後比直 線性特性が得られるように、非線型アンプを設計するこ とにより、高信頼度の光送信装置が実現できる。

【0024】また、実施例の説明図4においては、EA変調器集積レーザを一定の温度に制御するための部品、ペルチェ112、サーミスタ113、及び温度制御回路116を記載しているが、これらの部品がなく、温度制御が必要でない半導体レーザモジュール場合においても、本発明の効果は変わらない。さらに、実施例の説明図4においては、非球面レンズ113、セルフォックレンズ114、及びアイソレータ115が無いような、い40わゆる簡易パッケージにおいても、本発明は同様の効果が得られることは言うまでも無い。

〈実施例2〉図9は、本発明による光送信モジュールの他の実施例の構成を示す。本実施例は伝送速度10Gbit/sのEA変調器集積レーザを搭載したものである。図9の光送信モジュール601の基本構成は、実施例1で説明した図4における光送信モジュール106とほぼ同様で、図4の構成部分と実質的に同じ部分には同じ番号、符号で示し、その詳細な説明は省く。図9の構成と図4の構成との違いは、非線型アンプ802を半導体レーザモジ 50

ュール601内に搭載した点である。フォトダイオード 109によりO/E変換された出力電流 I pが、半導体 レーザモジュール内に搭載された非線型アンプ802を 介して、半導体レーザモジュールのモニタ電流出力 I q となる。

【0025】非線型アンプ802の動作は、実施例1での説明と同様であり、これにより半導体レーザモジュール601の光ファイバー117への光出力と非線型アンプ802を介したモニタ電流出力Iqの比が、図3の点線Bで示すようなレーザ駆動電流依存性となり、レーザ駆動電流が変化した時点においても、ファイバー光出力を一定に制御することができる。

【0026】図9に示す実施例においては、EA変調器 集積レーザ601を一定の温度に制御するための部品、 ペルチェ112、サーミスタ111を記載しているが、 これらの部品がなく、温度制御が必要でない半導体レー ザモジュール場合においても、本発明の効果は変わらな い。さらに、図9に示す実施例においては、非球面レン ズ113、セルフォックレンズ114、及びアイソレー 20 タ115が無いようないわゆる簡易パッケージにおいて も、本発明は同様の効果が得られることは言うまでも無

【0027】また、波長多重伝送用として、波長をロッキングする機構を備えた波長ロッカ内蔵半導体レーザモジュールにおいても、この半導体レーザがEA変調器を集積したレーザである場合には本発明を用いることにより、駆動電流の変動に対してファイバ光出力が一定に制御可能な高信頼度な波長ロッカ内蔵半導体レーザモジュールが作製できる。

(実施例3)本発明の実施例について、伝送速度10Gbit/sの光伝送装置について説明する。実施例1で述べた光送信モジュールを搭載し、光伝送装置を構成することにより、経時変化、及び環境変化による半導体EA変調器集積レーザ駆動電流の変動にかかわらず、光出力を一定に制御することが可能となり、高い長期信頼性を有した光伝送装置が実現する。また、この光伝送装置を使用して、光伝送システムを構築することにより、信頼性の高い光伝送システムが実現できる。

<実施例4>図10は本発明によるEA変調器集積波長可変レーザを搭載した光伝送装置(光送信モジュール)の他の実施例の構成を示す。送信モジュール901の基本な構成は、実施例1(図4)での説明とほぼ同様であるが、異なる点は、図10において、EA変調器集積波長可変レーザ902が搭載されている点である。EA変調器集積波長可変レーザ902は、半導体レーザ部が波長可変レーザ903、EA変調機部108で構成されている点である。

【0028】波長可変レーザの場合においても、EA変調器が波長可変レーザの前方に集積されているため、EA変調器集積波長可変レーザ素子自体では、実施例1で

の説明と同様に前後比直線性がレーザ駆動電流依存性を有する。さらに、波長を可変するため、EA変調器部分の吸収特性が変わるため、実施例1の波長が変わらない送信モジュールと比較して、前後比直線性の電流依存性が大きくなってしまう場合がありうる。このため、実施例1と同様に非線型アンプを搭載して光送信モジュールを構成することにより、半導体レーザ駆動電流が変動した場合においても、光出力を一定に制御することが可能となる。

〈実施例5〉図11は本発明によるEA変調器集積波長可変レーザを搭載した光伝送装置(光送信モジュール)のさらに他の実施例の構成を示す。半導体レーザモジュール1001の基本構成は、実施例2での説明とほぼ同様であるが、異なる点は、図9において、EA変調器集積波長可変レーザ902が搭載されている点である。EA変調器集積波長可変レーザ903、EA変調器部108で構成されている点である。この場合も、EA変調器集積波長可変レーザモジュールとして、実施例2と同様の効果が得られる。

【0029】以上、本発明の実施例について説明した が、本発明は上記実施例に限定されるものではない。さ らに本発明の光伝送装置として、光送信モジュールにつ いて説明したが、光送信モジュールに限定されるもので はなく、光送信モジュールを搭載した光伝送装置、光送 信モジュールを搭載した波長多重光伝送装置、これらの 光伝送装置を使用した光通信システムにも適用される。 伝送速度10Gbit/s程度の波長多重光伝送おいては、各波 長ごとに異なる光送信モジュールで構成するため、モジ ュールの個体差、及び光伝送装置内のフィルタ、波長合 30 波器等の部品の波長依存性により、光出カレベルが異な ってしまう恐れがある。しかしながら、光伝送装置にお いては光伝送システムの構成上、各波長の光出力レベル を一定揃えて制御する必要がある。この光出カレベル制 御のためには、実施例1で述べた光送信モジュ搭載し、 波長多重光伝送装置を構成することにより、波長多重光 伝送装置に適した光出力制御が可能となり、高い長期信 頼性を有した波長多重光伝送装置が実現する。

【0030】また、波長多重光伝送装置を使用して、波 長光伝送システムを構築することにより、システムを構 40 成する波長依存性のある部品、例えば光ファイバ、光ア ンプ、光スイッチ等に応じて、光出力制御が可能とな り、信頼性の高い波長光伝送システムが実現できる。 【0031】

【発明の効果】本発明では、幹線系光伝送の重要な部品の一つである、半導体電界吸収型変調器集積レーザの本質である前方後方比直線性劣化を、非線型アンプを入れることによりこれを搭載した半導体レーザモジュール、

及び光送信モジュールにて補正するため、半導体レーザモジュール、及び光送信モジュールの光出力安定性や信頼性が向上する。さらにこれらの光送信モジュールを用いることにより、経時変化、及び環境変化による半導体EA変調器集積レーザ駆動電流の変動にかかわらず、光出力を一定に制御することが可能となり信頼度の高い光伝送装置、及び幹線系光伝送システムの構築が実現できる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】従来の光送信モジュールの構造を示す回路図 【図2】従来の光送信モジュールの動作説明のための

【図2】従来の光送信モジュールの動作説明のための特 性図

【図3】従来技術及び本発明による光送信モジュール特性比較図

【図4】本発明による半導体レーザ装置の第1実施例の 回路図

【図5】本発明による半導体レーザ装置における非線型 アンプの出力特性図

【図6】本発明による半導体レーザ装置における非線型 20 アンプの増幅特性図

【図7】本発明による半導体レーザ装置における非線型 アンプの実施例の構成図

【図8】本発明による半導体レーザ装置における非線型 アンプの入出力特性図

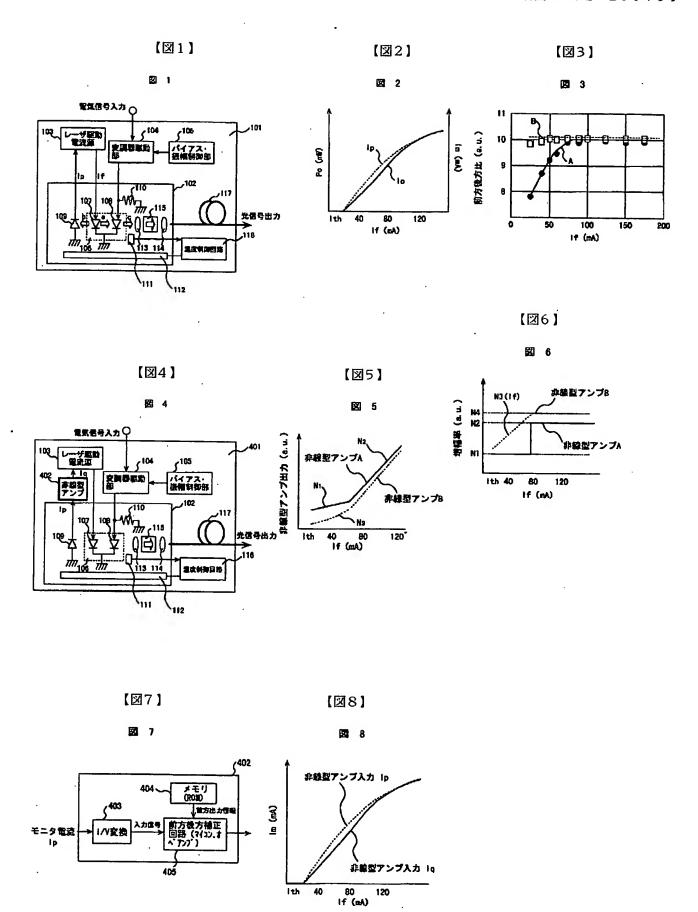
【図9】本発明による半導体レーザ装置の第2実施例の 回路図

【図10】本発明による半導体レーザ装置の第4実施例 の回路図

【図11】本発明による半導体レーザ装置の第5実施例の回路図

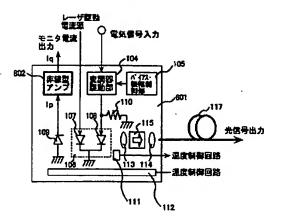
【符号の説明】

101・・・光送信モジュール、102・・・半導体レ ーザモジュール、103・・・レーザ駆動電流源、10 4・・・変調器駆動部、105・・・バイアス振幅制御 部、106···電界吸収型(EA)変調器集積DFB レーザ、107··・電界吸収型変調器部(EA変調器 部)、108···DFBレーザ部、109···モニ タフォトダイオード、110・・・終端抵抗、111・ ・・ミスタ、112・・・・ペルチェ基板、113・ ・・面レンズ、114・・・・セルフォックレンズ、 115・・・アイソレータ、116・・・温度制御回 路、117・・・光ファイバ、401・・・実施例1に よる光送信モジュール、402・・・非線型アンプ、8 01・・・実施例2による半導体レーザモジュール、9 01・・・実施例5による光送信モジュール、902・ ・・EA変調器集積波長可変レーザ、903・・・波長 可変レーザ部、1001・・・実施例6による光送信モ ジュール、



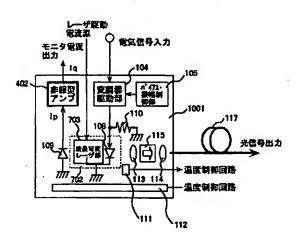
【図9】

22 9



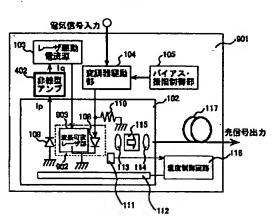
【図11】

2 11



【図10】

図 10



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H O 4 B 10/04

10/06

10/152

10/142

(72)発明者 東口 晃久

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株式会社日立製作所通信事業部内

(72) 発明者 加藤 哲哉

神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株 式会社日立製作所通信事業部内

Fターム(参考) 5F073 AA64 AB14 AB27 AB28 BA02

EA15 EA28 FA02 FA05 GA03

GA12 GA14 GA22 GA23 GA24

5K002 AA02 BA13 CA09 FA01

BEST AVAILABLE COPY